

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年2月17日(2005.2.17)

【公開番号】特開2002-217154(P2002-217154A)

【公開日】平成14年8月2日(2002.8.2)

【出願番号】特願2001-7156(P2001-7156)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/304

B 08 B 5/02

B 08 B 7/04

【F I】

H 01 L 21/304 6 4 5 A

H 01 L 21/304 6 4 5 C

H 01 L 21/304 6 4 8 G

B 08 B 5/02 A

B 08 B 7/04 Z

【手続補正書】

【提出日】平成16年3月9日(2004.3.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

真空排気手段により排気された真空容器内にて、被処理ウエハの表面および裏面に近接または接してパット型構造体をそれぞれ配置させ、

該構造体と該被処理ウエハの間にガスを供給し、

該構造体を被処理ウエハに対して相対的に移動させることで被処理ウエハ表面および裏面を洗浄することを特徴とするドライ洗浄方法。

【請求項2】

請求項1記載のドライ洗浄方法において、

被処理ウエハの表面および裏面に近接または接して配置される前記構造体の大きさが被処理ウエハ径より小さいことを特徴とするドライ洗浄方法。

【請求項3】

請求項1または2記載のドライ洗浄方法において、

真空容器内にプラズマを形成する手段を付加し、該プラズマと該表面および裏面に配置した構造体の作用により被処理ウエハ面を洗浄することを特徴とするドライ洗浄方法。

【請求項4】

被処理ウエハの表面および裏面の各面に配置される構造体の隙間にガスを供給し、

被処理ウエハの表面および裏面に配置した構造体に作用する圧力を検知し、

該圧力が一定となるよう構造体の被処理ウエハへの押付け力を制御することで被処理ウエハと構造体の間隔を制御し、該ガスにより該被処理ウエハの表面および裏面を洗浄することを特徴とするドライ洗浄方法。

【請求項5】

請求項4記載のドライ洗浄方法において、

該構造体と該被処理ウエハの隙間にガスを供給する方法は、該構造体の被処理ウエハ面に接する面の中央部に形成したガス噴出し孔より該被処理ウエハ面に向けて噴出される構造

であることを特徴とするドライ洗浄方法。